

2026 年 関西表面技術シンポジウム
ウェットプロセスを基盤とした材料技術の次世代育成

電気鍍金研究会
表面技術協会関西支部
表面技術協会ウェットプロセス研究部会

電気鍍金研究会の「次世代めっき技術連携開発プロジェクト第8期」の中間報告と電気鍍金研究会および表面技術協会関西支部の特別講演会を兼ねて表記のシンポジウムを開催いたします。多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。

日 時： 2026 年 7 月 22 日(水) 13:00～17:00

方 式： 会場での講演・聴講と Zoom による聴講のハイブリッド開催

会 場： 大阪鍍金会館 (〒537-0025 大阪市東成区中道 3-1-14) JR 環状線 玉造駅 下車徒歩 5 分

参加費： 会員・学生：無料， 非会員：3,000 円（事前振込）

（講演資料は PDF による電子配布を予定）

※会員資格を確認後、非会員には振込先をお知らせいたします。（振込期限：7/15(水) まで）

申込方法：参加希望者は、7月9日(木)までに裏面の方法によりお申込みください。

定 員： 100 名（先着順）

プログラム

13:00-14:00 講演：バイポーラ現象を利用した表面処理技術～電解着色からアルマイトまで～

工学院大学 先進工学部 応用化学科 阿相 英孝

電気めっき時の異常現象としてバイポーラ現象が古くから知られているが、近年、その現象を積極的に活用したバイポーラ電気化学が注目されている。本講演では、バイポーラ電気化学に基づく表面処理技術について紹介する。

14:10-17:00 次世代めっき技術連携開発プロジェクト中間報告会（各 15 分間の発表＋質疑 5 分）：

1. アルミニウム合金の機械特性を向上させる表面処理技術の開発（Ⅳ）（14:10-14:30）

広島工業大学・○日野 実、上村工業（株）・黒坂成吾、大久保洋樹

2. 電解析出法による強度・延性バランスと機能性に優れた金属材料の創製（Ⅲ）（14:30-14:50）

大阪公立大学・○瀧川順庸、渡邊 充

3. エネルギー変換材料への応用を目指した

ウェットプロセスによるスプラウト状微細構造物の構造制御（14:50-15:10）

大阪公立大学・岡本尚樹

4. キラル形状を有する鋳型中での無電解析出反応によるキラルな金属ナノ構造体の創製

（15:10-15:30）

（地独）大阪産業技術研究所・○中谷真大、池田慎吾、小林靖之

休憩（10 分）

5. 次世代に向けた銅めっき技術の開発と膜構造の最先端解析 (15:40-16:00)

兵庫県立大学・○福室直樹、坂本祥隆、田尾拓磨、林 巧真、深堀 翔、八重真治
日本電鍍工業(株)、兵庫県立大学・寺内亮一

6. 高周波利用を目的とした磁性薄膜のウェットプロセス形成 (16:00-16:20)

奈良工業高等専門学校・藤田直幸

7. 鉄系めっき膜の陽極酸化を用いた機能性電極の作製とその高機能化 (16:20-16:40)

(地独) 京都市産業技術研究所・紺野祥岐

8. 電気 Ni 系合金めっき皮膜の適用拡大 (16:40-17:00)

(地独) 大阪産業技術研究所・○長瀧敬行、酒井大祈

※ 申込先: <https://forms.gle/zX5j3N4LXAMmn4BQ9>



締切り: 7月9日(木)

参加登録された方には後日、Zoom 接続先、講演資料等を送らせていただきます。

※講演の録音、録画は禁止させていただきます。参加者限定の情報を第三者に伝えないで下さい。
禁止事項に同意いただけない方は参加をお断りさせていただく場合がございます。

<連絡先> 電気鍍金研究会事務局 TEL/FAX 06-4259-6890